

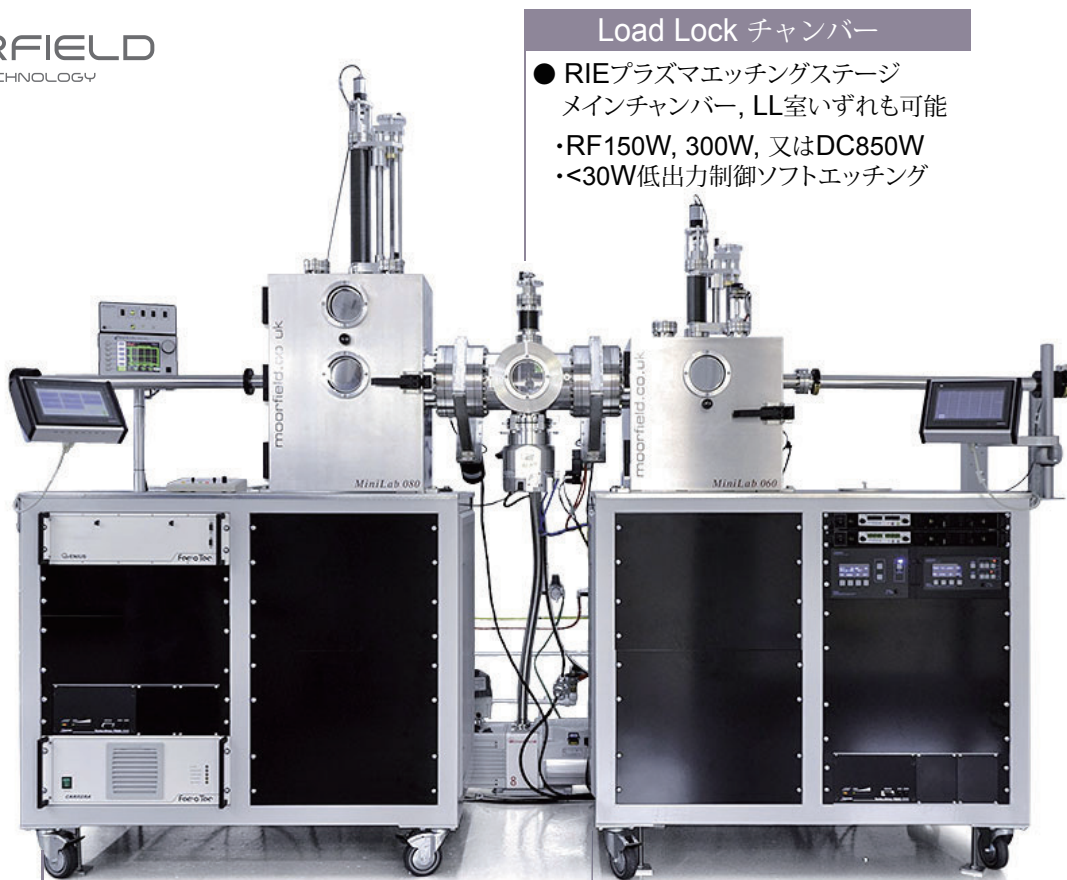


MiniLab Dual chamber deposition system

蒸着/スパッタ・デュアル・チャンバー・システム(～Φ8inch基板対応)

2台の薄膜実験装置をロードロック機構で連結。異なる成膜装置（スパッタ - 蒸着、など）をロードロックでシームレスに連結。Moorfield Nanotechnology 社独自のロードロックシステムにより、左右・後方へのプロセス室への連結も可能（写真下）。ロードロック室では「RIE プラズマエッチングステージ」によるプラズマ表面改質クリーニング、又、同社独自の『ソフトエッチング』技術による <30W 低出力 /10mW 高分解能・ダメージレスプラズマエッチングステージも搭載可能。2D（PMMA 等のレジスト除去など）、グラフェン剥離、又、テフロン基板などのダメージを受けやすい繊細なエッチングプロセスも可能。（*メインチャンバーステージへも搭載可能です）

MOORFIELD
NANOTECHNOLOGY



Load Lock チャンバー

- RIEプラズマエッチングステージ
メインチャンバー, LL室いずれも可能
- RF150W, 300W, 又はDC850W
- <30W低出力制御ソフトエッチング

MiniLab-EB080A EB蒸着装置

寸法: 1,120(W) x 800(D)

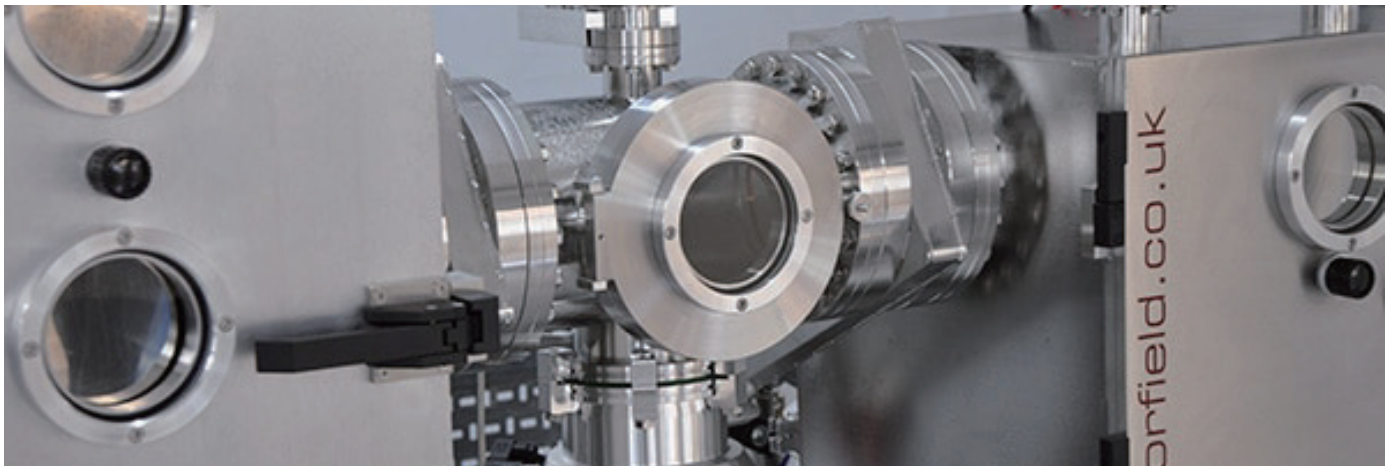
- 電子ビーム銃: 7cc x 6るつぼ
- 抵抗加熱蒸着源: x 2
- 有機材料蒸着源: x 2

MiniLab-S060A スパッタリング装置

寸法: 1,120(W) x 800(D)

- Φ2inchマグネトロンカソード x 4源
- DC, RF電源
- 4源同時スパッタ

装置構成事例①



MiniLab-EB080A EB蒸着装置

【チャンバー仕様】

- 400(W) x 400(D) x 570(H)
- SUS304フロントローディング式
- Φ90mmビューポート x 2
- 到達真空度 5x10⁻⁵ Pascal

【基板ステージ】

- Φ1inch～Φ11inch基板対応
- 基板回転(回転速度30段階速度可変式)
- 基板加熱ヒーター
500℃ハロゲンランプヒーター
800℃C/Cコンポジット、又はSiCコーティング

【電子ビーム】

- 回転式つぼ:7cc x 6、又は4cc x 8つぼ
- 270°ビーム偏光 X-Yスイープ
- 6KW電源(標準)
- ハンドヘルドターミナル付属

【抵抗加熱蒸着】

- TE1ボックス型蒸着源 x 2式
- タングステンフィラメント(ボート、バスケット他対応)
- 1500℃, 100A, 8V
- 水冷電極

【有機蒸着】

- LTE型蒸着源 x 2式
- タングステンフィラメント(石英つぼ1cc)
- 80～600℃
- 水冷電極

その他仕様

- APC自動圧力制御
- 真空ポンプ:TMP +ロータリー(又はドライスクロール)
- ワイドレンジ真空計(Baratron オプション)
- 基板シャッター、ソースシャッター
- 水晶振動子膜厚センサー
- SQC-31-, SQM-160薄膜コントローラー(オプション)

MiniLab-S060A スパッタリング装置

【チャンバー仕様】

- 400(W) x 400(D) x 400(H)
- SUS304フロントローディング式
- Φ90mmビューポート x 1
- 到達真空度 5x10⁻⁵ Pascal

【基板ステージ】

- Φ1inch～Φ11inch基板対応
- 基板回転(回転速度30段階速度可変式)
- 基板加熱ヒーター
500℃ハロゲンランプヒーター
800℃C/Cコンポジット、又はSiCコーティング

【マグネトロンスパッタリング】

- Φ2inchマグネトロンカソード x 最大4源
- Φ3inchカソードの場合 x 最大3源
- 磁性材料用高強度マグネット(オプション)
- 水冷式、傾斜フレキシブルアングルヘッド
- RF150W, 300W, 又はDC850W
- HiPIMS電源(PulseDC 5KW)も併設可能
* プラズマリレー SW で HMI 画面より自在に
4カソードへの電源分配・配置設定の変更が可能
- MFCガス x 最大3系統(Ar, O₂, N₂)

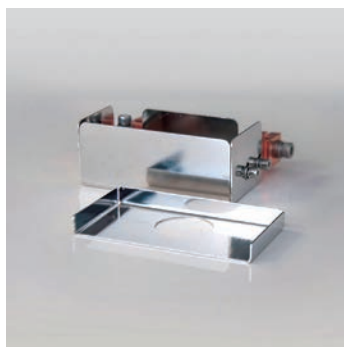
【RIEプラズマエッチングステージ】

- RF150W, 300W, 又はDC850W
- <30W低出力制御ソフトエッチング

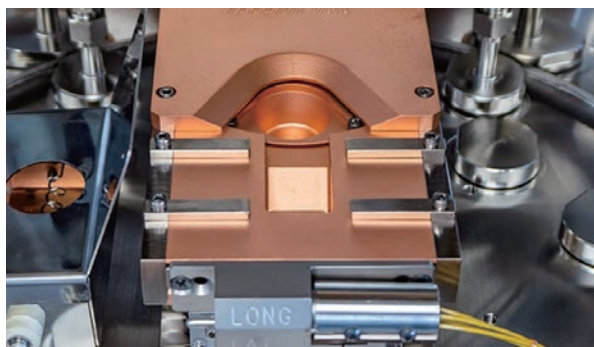
ロードロックチャンバー

- RIEプラズマエッチングステージ
メインチャンバー, LL室いずれも可能
- RF150W, 300W, 又はDC850W
- <30W低出力制御ソフトエッチング

装置構成事例①



抵抗加熱蒸着源



電子ビーム銃



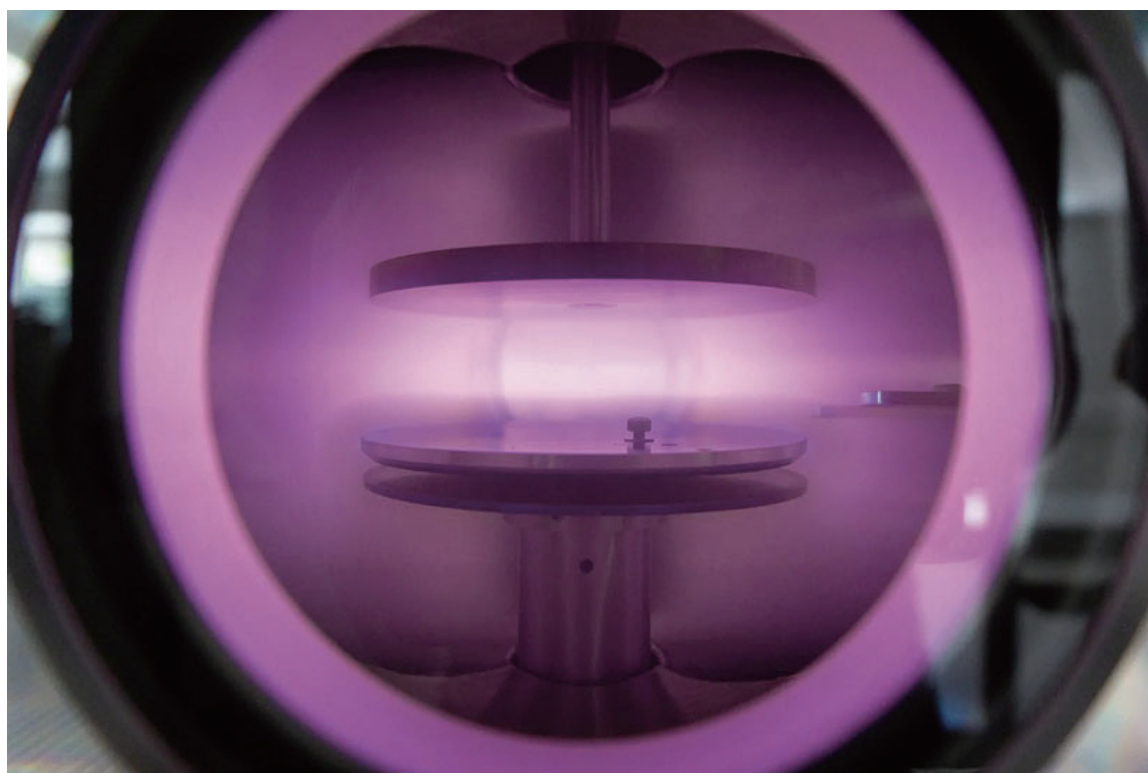
有機蒸着源



スパッタリングカソード



ロードロック搬送機構



RIEプラズマエッチングステージ(メインチャンバー, LL室いずれも可能)

- RF150W, 300W, 又はDC850W
- <30W低出力制御ソフトエッチング